



4#碱铜电镀工艺

ISSUED: 2016/03/28

REVDAT: 2018/12/16

一、简介

1. 镀层完全光亮，结晶细，延展性好
2. 分散能力佳，为大部分金属之理想底镀工艺
3. 光剂稳定，操作容易
4. 具高度填平力和超卓覆盖力

二、镀液组成及操作条件

氰化钾配方

原料及操作条件	范 围	标 准
氰化铜含量	75 克/升	75 克/升
氰化钾	127 克/升	127 克/升
KOH	1-3 克/升	-----
诺切液	30-50 毫升/升	50 毫升/升
3#辅助剂	5-7 毫升/升	5 毫升/升
4#主光剂	5-7 毫升/升	5 毫升/升
电流密度	2-5 安培/平方分米	2-5 安培/平方分米
搅拌方法	阴极摇摆	阴极摇摆（4-8 循环/小时）
过滤	连续过滤	连续过滤
温度	55-65℃	60℃
阳极	无氧电解铜	

氰化钠配方

原料及操作条件	范 围	标 准
氰化铜含量	51-71 克/升	60 克/升
氰化钠	73-98 克/升	84 克/升
KOH	1-3 克/升	-----
诺切液	30-50 毫升/升	50 毫升/升
3#辅助剂	5-7 毫升/升	5 毫升/升
4#主光剂	5-7 毫升/升	5 毫升/升
电流密度	2-5 安培/平方分米	2-5 安培/平方分米
搅拌方法	阴极摇摆	阴极摇摆（4-8 循环/小时）

过滤	连续过滤	连续过滤
温度	55-65℃	60℃
阳极	无氧电解铜	

三、光亮剂作用和补充

诺切液 降低阳极钝化，促进阳极溶解。含量为 30-50ml/L。

主光剂 4# 与辅助剂配合使用，能得到由高至低电流密度同样光亮的镀层。

辅助剂 3# 能使高电流密度区光亮，内含表面活性剂，降低镀层出现针孔的机会。

四、药品添加：

添加剂	消耗量（每 1000A. h）
3#辅助剂	100 毫升
4#主光剂	300 毫升

五、镀缸维护

每次添加主盐后，都要进行低电流处理

每个星期最好用碳芯将镀液过滤一晚

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。